

Forno De Grafitação De Película De Alta Condutividade Térmica

Número do item: GF-03



introdução

O forno de grafitação de película de alta condutividade térmica tem temperatura uniforme, baixo consumo de energia e pode funcionar continuamente.

[Saiba mais](#)

Especificações do modelo do produto	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
Volume (L)	125	196	282	1000
Temperatura nominal (C)	2800	2800	2800	2800
Temperatura limite (C)	3100	3100	3100	3100
Área de aquecimento efectiva (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
Potência (KW)	150	200	30	600
Frequência(HZ)	1500	1000	1000	1000
Método de controlo da temperatura	Termóstato elétrico Shima do Japão			
Método de aquecimento	Aquecimento por indução			
Sistema de vácuo	Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de difusão de óleo)			
Atmosfera de sinterização	N ² Ar e outros gases			
Tensão nominal de alimentação (V)	380			
Tensão nominal de aquecimento (V)	750			
Limite de vácuo (Pa)	100 (estado frio de vácuo)			